文章编号: 0258-7025(2002)05-0436-03

AgO_x 薄膜的光开关特性和机理研究

熊曹水^{1,2},熊永红³,赵天鹏²,罗震林²,明 海²

(中国科学技术大学¹结构成分分析中心,²物理系,³天文与应用物理系,安徽合肥 230026)

提要 用磁控溅射法制备了具有超分辨近场结构的系列薄膜,测量了非线性层 A_{gO_x} 的光开关特性及其结构随温度的变化,分析了 A_{gO_x} 的光开关特性与微结构之间的内在联系。 关键词 磁控溅射,超分辨近场结构, A_{gO_x} 薄膜,开关特性 中图分类号 $O_484.1$ 文献标识码 A

An Approach for Optical Switching Property and Mechanism of AgO_x Thin Films

XIONG Cao-shui^{1,2}, XIONG Yong-hong³, ZHAO Tian-peng², LUO Zhen-lin², MING Hai² (¹Structure Research Laboratory, ²Department of Physics, ³Department of Astronomy and Applied Physics, University of Science and Technology of China, Hefei 230026)

Abstract A series of super RENS thin films were fabricated using magnetron sputtering technique. The dependence of relative transmission intensity and microstructure of AgO_x (magic layer) on temperature was measured. The interrelation between the optical switching property and microstructure of AgO_x film was analysed. Key words magnetron sputtering technique, super RENS, AgO_x thin film, optical switching property

1 引 言

为了提高光存储密度,近几年人们提出了各种 新思想、新概念和新理论,相应的新材料、新器件和 新技术也竞相问世。比如全息存储和近场光学存储, 从原理上说有其可行之处,但是却很难在实际中应 用。因为近场光学存储中光纤探针和记录介质间的 距离难以控制,全息存储又难以与光盘兼容。1998 年发展起来的超分辨近场结构(Super-RENS (super resolution near-field structure))克服了上述重 大障碍,成为超高密度大容量光盘存储最明朗、最有 前途的发展方向。预计到 2005 年,记录密度大于 10 Gb/cm² 的超高密度大容量光盘可以面世,它比现 有的光盘记录密度要高 1 个数量级以上。

利用超分辨近场结构的超高密度大容量数据存 储材料的研制和开发是近两年来国际上的一个研究 热点,日本的 J. Tominaga,台湾大学的蔡定平已经 进行了一些原型实验,并取得了可喜的进展^[1~3]。但

是尚有许多关键问题,尤其是材料和机理的研究亟 待解决。

利用上述技术的关键是 PC(0.6 mm)/SiO₂ (170 nm)/Sb(15 nm)/SiO₂(20 nm)/Ge₂Sb₂Te₅(15 nm)/SiO₂(20 nm)系列薄膜样品和 PC(0.6 mm)/ ZnS:SiO₂(130 nm)/AgO_x(15 nm)/ZnS:SiO₂(40 nm)/Ge₂Sb₂Te₅(20 nm)/ZnS:SiO₂(20 nm)系列薄 膜样品中的非线性层(magic layer)Sb 和 AgO_x 所 起的重要的光开关作用。

对于 Sb 或 AgO_x 的光开关效应产生的机理目 前并不十分清楚,几种现有的解释为:对于 Sb,当激 光束聚焦在 Sb 薄膜上时,在 90℃附近引起了一个 从非晶态到晶态的转变,在 Sb 薄膜层对于激光束 高斯光束的非线性光学吸收,从而形成了超瑞利分 辨极限的孔径,因此光学的近场记录和读出可以通 过这些孔径进行。对于 AgO_x,则认为可能是在 180℃附近有一个分解过程,即 AgO_x 分解成 Ag 颗

基金项目:国家重点基础研究 973 项目 G19990330 资助项目。

收稿日期:2001-03-01; 收到修改稿日期:2001-05-21

作者简介:熊曹水(1953—),男,毕业于中国科学技术大学物理系,现为华中科技大学物理系教授。主要从事磁性材料、薄 膜材料和纳米材料的制备、结构和物性分析。E-mail:csxiong@hust.edu.cn

粒和 O₂,早期人们依据无孔近场扫描显微镜原理提 出近场记录模型。最近蔡定平又进一步解释:即在 Ag 颗粒周围会产生一些表面等离子体,由于表面 等离子体的增强效应而起到了光开关作用,实现了 近场光记录。

本文报道了我们进一步探讨 AgO_x 的光开关特 性和机理的研究的一些实验结果,着重讨论了温度 效应对 AgO_x 光开关层的影响。

2 实验方法

采用磁控溅射法制备了几个系列样品,制备条 件为:直流溅射电压 260 V,电流 0.2 A;射频溅射功 率 200 W;溅射前本底真空为 9×10^{-5} Pa,溅射时压 强为 3 Pa;溅射时气流分别为:Ar—10SCCM,O₂— 10SCCM,其中 SCCM=每分钟标准毫升;基片为玻 璃或聚碳酸酯(简称为 PC),基片温度分别为室温和 100 C。在制备样品的过程中,我们改变了不同非线 性层材料(AgO_x和 Sb),不同厚度(5 nm,10 nm,15 nm 和 20 nm),AgO_x中不同氧含量、不同的缓冲层 和保护层(SiO₂,SiN 和 ZnS:SiO₂等),目的是想重 点研究非线性层或光开关层(magic layer)中 AgO_x 或 Sb 这一类光开关层材料所起的重要作用,以便 从机理上搞清楚,并指导下一步的研究。

样品的结构分析是在日本的精密 X 射线衍射 仪(MXP18AHF)上完成的,测量温度从室温升到 210℃,然后再降回室温,以测量样品的结构随着温 度上升和下降时的变化情况。

样品的光开关效应,是指样品的相对透射光率 随温度的变化关系,作者制作了专门测试装置,测量 样品的光开关特性,所用的光源是 650 nm,5 mW 半导体激光器。

样品的微结构是在扫描隧道显微镜(STM)上 测量的。

3 结果和讨论

经过初步测量 $SiO_2/AgO_x/SiO_2$ (50 nm/15 nm/15 nm)和 $SiO_2/Sb/SiO_2$ (50 nm/15 nm/15 nm)两个系列的样品后,发现 $SiO_2/AgO_x/SiO_2$ 的光开关效果最好。图1给出了 $SiO_2/AgO_x/SiO_2$ 薄膜的相对透射光强随温度的变化关系(插图是 $SiO_2/Sb/SiO_2$ 薄膜的相对透射光强随温度的变化关系)。由

图 1 可以看出, SiO₂/AgO_x/SiO₂ 薄膜在 180℃附近,透射光强有明显的增强,而 SiO₂/Sb/SiO₂ 薄膜 在 90℃附近,透射光强只有缓慢的增加。这些结果 与别的研究小组报道的研究结果基本类似。



图 1 相对透射光强与温度的变化关系

Fig. 1 Dependence of relative transmission intensity on temperature



图 2 不同温度时的 X 射线衍射图 Fig. 2 X-ray diffraction patterns of AgO_x at different temperature

通过进一步结构分析,初步探讨了 $A_{g}O_{x}$ 的光 开关效应的机理。图 2 给出了不同温度的 X-射线粉 末衍射图。由这些衍射图可以看出,在室温时,光开 关层的基本成分为 $A_{g}O_{0.5}$ 。随着温度的升高, $A_{g}O_{0.5}$ 开始分解,在 200℃附近, $A_{g}O_{0.5}$ 完全分解为 A_{g} 和 O_{2} ,这一结果与别的研究小组报道的结果相 同,但是我们首先给出了完整的 $A_{g}O_{x}$ 的 X-射线粉

末衍射图与温度的变化关系。表 1 给出了 $A_{gO_{0.5}}$ 和 A_{g} 的结构参数。

表1 AgO0.5和 Ag 的结构参数

Table 1 Structure parameters of $AgO_{0.5}$ and Ag

$\mathrm{AgO}_{0.5}$			Ag		
Cubic system P _{N3M} (224)			Cubic system F _{M3M}		
Cu $\lambda = 0.15405 \text{ nm}$			Cu $\lambda = 0.15405$ nm		
d /nm	Ι	hkl	d /nm	Ι	hkl
0.3348	4	110	0.2359	100	111
0.2734	100	111	0.2044	40	200
0.3670	35	200	0.1445	25	220
0.1674	18	200	0.1231	26	311

根据这些结果,我们可以初步判断,温度效应也可以使 $A_{g}O_{x}$ 分解为 A_{g} 和 O_{2} ,从而产生光开关效 应。

图 3 为 STM 的测试结果。所用样品为两组,一 组是升温前的薄膜,由于此时样品为氧化物,电阻非 常大,因而无法用 STM 测量;另一组样品为升温到 200℃时的薄膜,此时样品已经成为 Ag 薄膜。由图 3 可以看出,Ag 膜是由一些颗粒大小不均匀的团簇 组成,最小的团簇大约为 30 nm,最大的团簇大约为 200 nm。

图 4 是图 3 的放大,并加上了三维旋转技术而 得。由图可以看出,颗粒或团簇不太均匀,表面略有 些不平整。

综上所述,我们认为,由于激光束照射或温度效 应,使得 AgO_x 分解为颗粒大小不均匀的 Ag 团簇, 而且表面不平整。正是这样的粗糙表面和无序的介 质分布,满足了产生局域表面等离子体的激发和



图 3 Ag 膜的 STM 图像 Fig. 3 STM picture of Ag film





Fig. 4 Magnefied picture of Fig. 3

效应的条件,保证了激光束在通过 AgO_x 非线性层 时近场强度的增加和聚焦斑点的减小,最终完成了 超高密度的光存储的记录和读出。

致谢 作者感谢材料科学和工程系李晓光教授提供 镀膜设备,理化中心陈琳教授测量薄膜样品的结构 与温度的变化关系。

参考文献

- J. Tominaga, T. Nakano, N. Atoda. An approach for recording and readout beyond the diffraction limit with an Sb thin film [J]. *Appl. Phys. Lett.*, 1998, 73(15): 2078~2080
- 2 T. Fukaya, J. Tominaga, T. Nakano *et al.*. Optical switching property of a light-induced pinhole in antimony thin film [J]. *Appl. Phys. Lett.*, 1999, **75** (20): 3114~3116
- 3 Din Ping Tsai, Wei Chih Lin. Probing the near fields of the super-resolution near-field optical structure [J]. Appl. Phys. Lett., 2000, 77(10):1413~1415